(9日本国特許庁

①特許出願公開

公開特許公報

昭53-45679

60Int. Cl.2

B 01 J 17/18 #

C 01 B 33/02

識別記号

砂日本分類 13(7) D 522.2 99(5) A 02

10 R 33

庁内整理番号 7158-4A 6370-57

7047-42

❸公開 昭和53年(1978)4月24日

発明の数 1 審査請求 有

(全3頁)

シリコン単結晶引上装置

顧 昭51-120355

20出

创特

願 昭51(1976)10月8日

郊発 明 者

江頭悦郎

小平市上水本町1450番地 株式

会社日立製作所武蔵工場内

同

藤田正人

小平市上水本町1450番地 株式

会社日立製作所武蔵工場内

炒発 明 者 三好信一郎

小平市上水本町1450番地 株式 会社日立製作所武蔵工場内

砂出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内一丁目 5

番1号

が代 理 人 弁理士 薄田利幸

明 紐 春

発明の名称 シリコン単結晶引上装置

特許請求の範囲

るつぼ、ヒーター、シールド及びシードナヤツ クその他の恩鉛製加熱治具をシリコンカーパイト でそれぞれ被つてなることを特徴とするシリコン 単結晶引上姿質。

発明の詳細な説明

本発明はシリコン単結晶引上英**健に関するもの** である。

従来においては 0 2 - 8 1 単納品引上整置の加熱治具は原子炉用高純度カーポン材によりつくられていた。 ここでいう加熱治具とは加熱用ヒーター, るつぼ, ヒートシールドおよびその他引上炉内の治具類のうちで石英や銅等以外のカーポンでつくられた一切の治具のことである。

ととろで、02-81単結晶中にはドーブ用不 純物元素の他に酸素や炭素が無視できない程度に 含まれていることが知られている。そして、炭素 については炉内の黒鉛治具から加熱によつてガス 化したのあるいはののが溶融したシリコン中に侵入することが主原因であることが明らかにされて

したがつて、特に低炭素濃度のB1結晶を得る にはP2(フローティングソーン)結晶法によら なければならなかつた。

 すなわち02-81単結晶引上法によれば1×

 10''~5×10''
 atoms / cc程度(通常の場合5×10''~1×10''

 合5×10''~1×10''
 atoms / cc)の炭素が含まれているので、それ以下の炭素濃度の単結晶81は02法では得られなかつた。

しかるに、B 1 単結晶中の炭素設度が1.5× 10¹⁷ a toms/ccを超えるとパワー用デバイス で特に問題とされるリーク電流の増大、耐圧の低 下が生じる。

したがつて、本発明は B 1 中の炭素濃度をより 低くすることを目的とするものである。

上記目的を遠成するための本発明の基本的構成 は、るつぼ、ヒーター、シールド及びシードチャ ックその他の無鉛製加熱治具をシリコンカーパイ

(1)

78 va 1653-45679 (2)

トでそれぞれ被つてなることを特徴とするものである。

以下本発明を実施例により説明する。第1図は 本発明の一実施例を示すものである。

回図において1 は溶融シリコンおよび石英ルツがを収納するるつぼ、2 は 8 1 を溶融するための熱を発生せしめる加熱ヒーター、3 は上部を被うトンプシールド、4 は装置の周辺部を被うアウターシールド、5 はインナーシールド、6 は底部において外部と遮酔するポトムシールド、8 は上記加熱ヒータに電力を伝える覚極(ブラグ)、9 はロアーシールド(ヒートリフレクタ)、10 はベデスタル、11 はシードを握むシードチャックである。以上の部品すべてはシリコンカーパイト(81c)でコーティングされている。

なお、B10は不良導体なので電板部分については電力伝達のため局部的にコーテイング層を剝しておく必要がある。

この本発明に係るシリコン単結晶引上接置によれば、接世内におけるカーボン材はカーボンウー

(3

とができる。

図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す引上装置の断面図である。第2図は炭素濃度を示す曲線図である。

1・・るつぼ、2・・ヒーター、3・・トップ シールド、4・・アウターシールド、5・・イン ナーシールド、6・・ポトムシールド、8・・電 極、9・・ロアーシールド、10・・ペデスタル、 11・・シードテヤック、12・・カーポンウー ル、13・・シード、14・・日1単結晶、15 ・・裕融シリコン、16・・石英ルツボ。

代理人 弁理士 雅 田 利 報

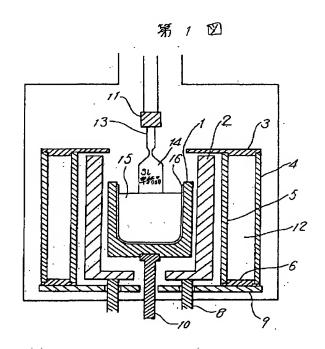
ルを除きすべて810Kより完全に覆われており、 また、カーポンウールについてはこれら810で コーティングされた治具で囲われ、開口部がない。

したがつて、加熱中にカーボン材に含まれる水 分や炉内界囲気中の設なの 2 と結合して発生し た 0 0 ガスあるいは劣化したカーボンそのものが 役粉体として溶腔シリコン中へ侵入することが防 止され、当然に 8 1 単結晶中の炭素温度が低くな るのである。

第2図は81単結晶中のカーボン盤に関して従来の県鉛治具を使用した場合と本発明の81Cコート治具を使用した場合とについて測定した結果を示するので、機軸の座標にFunction 8011dified (X) すなわち引上単結晶重量/チャージ結晶重量をとり、縦軸の座標に gabon Contents (単位atomic ppm)をとる。

マン この結果も明らかなように、本発明の方が炭素 : 設度が低いのである。

本発明はCZ単結晶引上装置全般に適用するC



(5)

133 四53-45679 (3)

